SFG(sum frequency generation) 和周波発生装置

全体図



目的

SFG 測定の最大の特徴は、計測対象の表面特性を観測できるという点で ある。固体や液体の表面だけでなく、光を通す物質であれば、固体 - 気体、 固体 - 液体、液体 - 気体、液体 - 液体の各種界面にも適用できる。さらに高 感度であるので、サブモノレイヤーまで計測することが可能である。また、 SFG は指向性を持つ光なので、空間的に迷光を除去できるという利点がある。 SFG を解析することで次のようなことがわかる。

- 表面吸着分子の識別とその基板または他分子との相互作用
- 各吸着種の分子種の表面濃度
- 吸着種のオリエンテーション分布
- 表面に対する分子の絶対方位
- 分子の励起状態の寿命
- 分子組成中の電子分布およびダイナミクス

原理

和周波発生(Sum Frequency Generation: SFG)は二次の非線形感受率⁽²⁾ に依存する三光子混合過程である。一般に二次の非線形感受率⁽²⁾は、電気 双極子近似のレベルで反転対称中心を持つ媒質中ではゼロとなる。従って、 この反転対称性が破れる表面(界面)でのみ和周波発生が起こる(Fig.1)。

SFGの界面振動分光法への応用では二種類のコヒーレント光(レーザー光) を用いる。入射するレーザー光の角振動数を 1、2とすると、発生するSFG 光(SFG)との間にはエネルギー保存則より次の式が成り立つ。

 $_{SFG} = _1 + _2$

SFG光の生成そのものに対する原理において、この 1と 2の間には特別の 制約はない。しかし、表面の振動状態をプローブする場合には、 1は波長 固定の可視光(VIS)、 2は波長可変の赤外光(IR)を用いる。このとき、和 周波光は赤外域レーザー光の振動数と計測表面の分子の振動数が一致する 時に発生する。Fig.2にSFG過程のエネルギーダイアグラムを、Fig.3に試料 の界面における入射光、反射光およびSFG光の光路を示す。Fig.3のような 場合、可視光が表面に対する法線から VISの角度で入射し、赤外光が IRで 入射する。すると表面からは、これらの反射光および透過光の他に、SFGが 指向性を持って界面から出射する。その反射方向を SFGとすると次式が成り 立つ。

_{SFG}sin _{SFG} = ₁sin _{VIS}+ ₂sin _{IR} SFG過程の非線形分極ベクトルP⁽²⁾は次式で表される。

 $P^{(2)}(_{SFG} = _{1} + _{2}) = ^{(2)} : E(_{VIS})E(_{IR})$

E は試料が感じる光の電場である。入射光の電場と反射光の電場の関係は、 フレネル係数を使って表すことができる。

界面におけるSFG現象を考える場合には、P⁽²⁾さらに⁽²⁾が界面でのみ(つ まり二次元のきわめて薄いシート上に)分布しているとみなす。さらに、実 際の実験にあわせてパルスレーザー(時間幅T、パルスあたりの強度とエネル ギーをそれぞれI、Uとする)を用いた場合に、発生するSFG光の光子数を求め ると、

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_{\text{SFG}}(\mathbf{r}, t) + \frac{n^2 (\underline{SFG})}{c^2} \mathbf{E}_{\text{SFG}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{P}^{(2)}(\mathbf{r}, t)$$

 $S(photons/pulse) = 128^{-3} |e_{SFG}\chi(2) : e_{VIS}e_{IR}|^2 I_{VIS}I_{IR}AT$

となる。ただし*c*は光速度、e は表面での単位電場ベクトル、A は2つのビームが重なる部分の面積である。

界面に存在する分子の振動や構造、さらには配向に関する情報は、非線形 感受率⁽²⁾に含まれている。⁽²⁾は次式で表される。

$$\chi^{(2)} = \chi^{(2)}_{\rm R} + \chi^{(2)}_{\rm NR}$$

 $\chi^{\scriptscriptstyle (2)}_{\scriptscriptstyle R}$ 及び $\chi^{\scriptscriptstyle (2)}_{\scriptscriptstyle NR}$ は共鳴及び非共鳴の二次非線形感受率である。表面吸着種の振

動状態との共鳴を考える場合、χ_R⁽²⁾は

$$(\chi_{\rm R}^{(2)})_{lmn} = \frac{\mathrm{NA_nM_{1m}}\rho}{\frac{1}{\mathrm{IR} - \frac{1}{\mathrm{V}} + i\Gamma_{\rm V}}}$$

と表される。I,m,nはデカルト座標軸x,y,zのどれかを表し、Nは表面の分子 数密度である。A_n及びM_{Im}それぞれ下式で与えられ、振動遷移|v> |g>の 遷移双極子モーメント及びラマン散乱テンソルに比例する。

$$M_{n} = \langle g | er_{n} | v \rangle$$

$$M_{1m} = \sum_{s} \frac{\langle g | er_{m} | S \rangle \langle S | er_{l} | g \rangle}{(\omega_{SFG} - \omega_{Sg})} - \frac{\langle v | er_{l} | S \rangle \langle S | er_{m} | g \rangle}{(\omega_{SFG} + \omega_{SV})}$$

ここで<v|、<s|、<g|はそれぞれ振動励起状態、中間状態、基底状態を表す。 は<g|、<v|との占有率の差、 vと vは振動共鳴周波数及びそのダンピ ング定数である。($\chi_R^{(2)}$)_{lmn}が0でない為には、その振動モードが赤外活性(A_n 0)かつラマン活性(M_{im} 0)であることが必要であることがわかる。さらに、 _{IR~ v}、つまり入射赤外光と表面振動の振動数が等しいときに共鳴条件が 満たされる。

χ⁽²⁾は振動非共鳴光、つまりバックグラウンドである。これは表面吸着系 に関しては次のような項の和で表せる。

$$\chi_{\rm NR}^{(2)} = \chi_{\rm SUB}^{(2)} + \chi_{\rm mol}^{(2)} + \chi_{\rm s-m}^{(2)}$$

ここで $\chi_{SUB}^{(2)}$ は基板、 $\chi_{mol}^{(2)}$ は吸着分子、 $\chi_{sm}^{(2)}$ は基板と吸着分子の相互作用にそれぞれ起因する非共鳴項である。金属や半導体表面では、 $\chi_{NR}^{(2)}$ はかなり大きい事が知られている。従って振動スペクトルを測定するときの SFG 信号のバックグラウンドがかなり強くなり、さらに $\chi_{NR}^{(2)}$ と $\chi_{NR}^{(2)}$ の干渉によりスペクトルが変形する。このスペクトル変形は詳細に解析すると表面に存在する分子の配向性に関する有用な知見を与える。

性能

SFG 装置は大きく分けて赤外領域と可視領域の2波長のレーザー光発生 部と試料部、そして SFG 光測定部からなる。Fig.4 に装置の概略を示す。レ ーザー発振源としてはモードロックピコ秒 Nd: YAG レーザーを用いた。レー ザー発振装置の詳細を次に示す。

波長 / nm	1064
パルス持続時間 / ps	20~30
(色素の濃度に依存)	
パルスエネルギーの安定度	± 1.5%
パルスエネルギー / mJ	50
ビーム直径 / mm	8
パルス繰返し数 / Hz	1 0

赤外光のポンプ光は Nd: YAG レーザーの基本波の1064nm を、可視光 のポンプ光は同じ Nd: YAG レーザーを使って得られる532nm を用いた。

試料から発生する SFG 光は、まず反射した 2 つのレーザー光と空間的に分離され、さらに光学フィルター、モノクロメーターを使って迷光を除去した後、光電子倍増管で検出される。



Fig.1 The interface selection characteristic of SFG.



Fig.2 The energy diagram of SFG process.



Fig.3 The way of the light of SFG process.



Fig.4 SFG spectrometer optical layout.

<u>起動操作</u>



<u>循環水を流す</u>

(2) Pump と Temp が点いているか確認。Alarm が点いていたら set を押す。

(1) スイッチ on

レーザーをスタンバイさせる



(1) 鍵を回す。

上の四つのランプが点いているか、Error が点いていないか確認。

(3) ボタンをゆっくり押し込む。

on



<u>オシロスコープの電源を入れる</u>



<u>DAQ unitの電源を入れる</u>

スイッチ on



<u>OPGの電源を入れる</u>



<u>PCを起動させる</u>

* 詳細は PC の起動の項参照



<u>レーザーを発振させる</u>

~ 2 6 mJ 程度

* 測定はレーザー発振後、20分以上経ってから行う。



<u>シャッターを開ける</u>

* 詳細はシャッターの開ける場所の図を参照



<u>アライメントしてサンプルをセットする</u>

- * 詳細はアライメントの項参照
- (注) 貴金属類ははずしておく。また、危ないのでサンプ ルを置くときは必ずシャッターを閉めておくこと。



<u>測定を行う</u>

* 詳細は測定の項参照

アライメント



アライメントは番号の順に行う。このとき、指輪、時計、ブレスレットなどは必ず はずしておく。また、印のついていない所は絶対にさわらない!

<u>赤外レーザーのガイド</u>

白い紙をどけるとガイドのレーザーが出る。赤外レーザーは目に見えないの でこれをもとに ~ のアライメントを行う。

<u>サンプル台</u>

サンプル台の高さ、角度を変えることができる。角度はほとんど 変える必要がないので右側面にある高さ調節だけを回す。のス リット(右の写真の四角でかこった部分)の中央にガイドレーザー



がくるようにサンプル台の高さを調節する。

*スリットはレバーを使って開閉できるので、スリットを 閉めてレーザーの位置を確認しながら調節する。

次に の 印のねじを回すとすぐ下の反射板の向きが変わるので、それを 調節してガイドレーザーが のスリットの中心に来るようにする。



今度は の 印のねじを使って検出器のスリットの中央にガイドレーザーがくるように調節する。



ガイドレーザーを遮断して赤外と可視のレー ザーをサンプルに照射する。検出される和周波の シグナルが最大となるように 印のねじを回し て調節する。シグナルは PC のディスプレイで確 認する。

<u>PCの起動</u>

SFG spectrometer アイコンをクリックしてソフトを起動させる

option から PG PL energy report mode をクリック

OPG energy report,PL energy report の両方に チェックを入れる。



SFG から SFG set up を選択し、signal をチェックし強度を max に上げる。波長 3000.00cm-1 の右の enter をクリック。Working の赤いランプの点灯が Success の緑色のランプの点灯に変わるまで待つ。



レーザーを発振させ、安定するまで待つ。

<u>測定</u>

Energy chart をクリックし、シグナルな最大になるようにアライメントする。



SFG から SFG Plot を選択し、測定範囲、step 数、Acq per step の条件を設定する。



start をクリックし、測定開始

